

先端半導体デバイスは構造の微細化および電子材料の多様化が急速に進んでおり、半導体製造に用いられるウェットプロセス技術の開発には、固体/液体界面における現象をナノレベルで理解することが必要となっています。本講演会では「ナノ界面現象の探求」をテーマとして、さまざまな分野の先生方にご講演いただきます。講演後オープンディスカッションも予定しており、最先端でどのような研究がなされているか、学び情報共有できる「場」を提供します。
なお当日は第22回カサロス(懇親会)を同時開催します。

ナノ界面現象の探求

■主催: 応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会

■第19回講演会実行委員

講演会実行委員長: 安藤景太(慶應義塾大学)

運営委員: 真田俊之(静岡大学), 萩本賢哉(ソニーセミコンダクタソリューションズ), 荒木浩之(SCREEN), 矢野大作(オルガノ), 吉田勇喜(関東化学), 永渕琢也(日本インテグリス)

■日時: 2017年3月17日(金) 13:00~17:00

■場所: 慶應義塾大学 矢上キャンパス (〒223-8522 神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1)
34棟3Fデザインセンター
《交通》東急東横線・東急目黒線・横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅下車15分

■プログラム: (当日変更の可能性があります)

(1)13:00~13:05 「開会の辞」

真田俊之(静岡大)

(2)13:05~13:50 招待講演「真空下での乾燥に耐えるナノスーツ -含水試料のありのまま電顕観察への応用-

石井大佑(名工大)

真島豊(東工大)

(3)13:50~14:35 招待講演「無電解金メッキ/電解金メッキによるナノギャップ電極」

(4)14:35~14:50 休憩

(5)14:50~15:35 招待講演「半導体クリーン化一筋 30年の軌跡(日本, アジア大企業奮闘記)」

白水好美(オフィスシラミズ)

(6)15:35~16:20 招待講演「拡張ナノ流体デバイスと溶液物性」

馬渡和真(東京大)

(7)16:20~16:30 休憩

(8)16:30~16:55 オープンディスカッション

(9)16:55~17:00 「閉会の辞」

安藤景太(慶應大)

18:00~20:00 「懇親会(カサロス)」 参加ご希望の方はお申し込み時にお知らせ下さい。

■参加費: 3,000円 (学生1,000円)

当日会場にてお支払い下さい。領収書を発行します。

■定員: 70名

■参加申込方法: e-mailにて下記までお申し込み下さい。

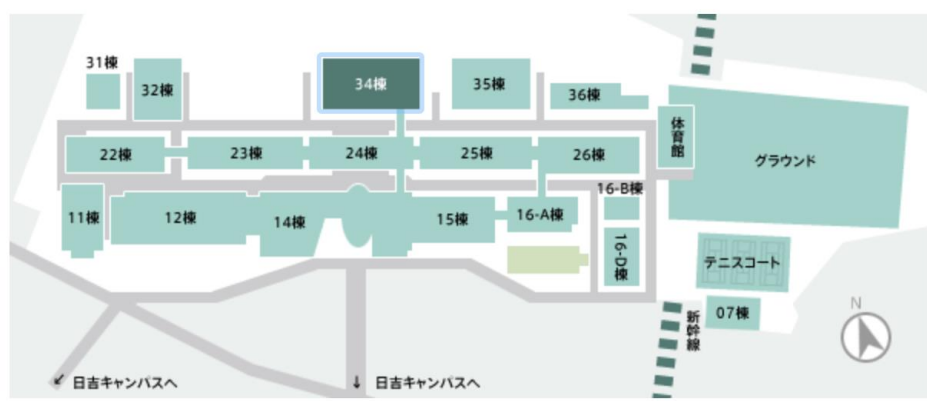
申込先: 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28

日本インテグリス株式会社リキッドフィルター応用技術部

永渕琢也 e-mail: takuya.nagafuchi@entegris.com

講演会会場案内

34棟 3F
デザインセンター



第22回カサロス（懇親会）の詳細ご案内

- 日時：2017年3月17日（金） 18：00～20：00
- 参加費：事前申込5,000円（INE学生会員無料） 当日参加6,000円
※カサロス会費について当日会場にてお支払い下さい。領収書を発行します。
- 申込締切：2017年3月3日（金）
- 定員：60名 ※定員に限りがあるので早めに参加お申込みください

カサロス会場案内

（カサロス会場）

「Foodiun Bar 一瑛」

- 会場名（店名）：Foodiun Bar 一瑛いちご新横浜
アリーナ通りビル店
TEL：050-3464-2472
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-7
いちご新横浜アリーナ通りビル5F
- 《交通》
横浜市営地下鉄 新横浜駅 徒歩1分
J R 新横浜駅 徒歩3分



- 参加申込方法：e-mailにて下記までお申し込み下さい。
申込先：〒108-0073 東京都港区三田1-4-28
日本インテグリス株式会社リキッドフィルター-応用技術部
永淵琢也 e-mail：takuya.nagafuchi@entegris.com